## 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56-32319

⑤Int. Cl.³C 01 B 33/02// H 01 L 21/1827/14

識別記号

庁内整理番号 6765-4G 6851-5F 6824-5F ④公開 昭和56年(1981)4月1日

発明の数 2 審査請求 有

(全 5 頁)

## **匈ケイ素材料の精製方法**

②特 願 昭55-99986

②出 願 昭55(1980)7月23日

優先権主張 Ø1979年8月16日③西ドイツ (DE)④P2933164.4

⑦発 明 者 ヨーゼフ・ディートル ドイツ連邦共和国ノイエツテイ ンク・アム・ベーレンバツハ17

⑦発 明 者 ミヒアエル・ヴォールシュレー ゲル

ドイツ連邦共和国ウンタープフ

3

明 細 書

#### 1. [発明の名称]

ケイ素材料の精製方法

## 2. 〔 特許請求の範囲〕

1. 太陽電池製作用のケイ素材料を酸溶液による使出によつて精製する方法において、本来公知の化学的精製段階と、10<sup>-6</sup>~10<sup>-4</sup>パールの圧力下、1500~1700℃の温度における真空蒸発とを組合わせて行うことを特徴とする精製方法。

2. 真空蒸発を繋による費出の後に続けて行う ことを特徴とする特許前求の範囲選1項配収の方 法。

3. 精製すべきケイ繋材料を20~60 μmの 粒度にまで粉砕することを特徴とする特許請求の 範囲第1項または第2項に記載の方法。

4. 酸容板として、水性塩酸とフッ水性化水素酸との混合物を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1点から第3項までの何れか1項に記載の方法。

5. ケイ共1 kg につき酸密酸 1 ~ 1 D L を加え

アツフエンホーフエン・フリー ドラントシユトラーセ13

⑪出願人 コンソルティウム・フユア・エレクトロへミツシエ・インドウストリー・ゲゼルシヤフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフッング

ドイツ連邦共和国ミユンヘン70 ツイールシユタツトシユトラー セ20

個代 理 人 弁理士 佐々木清隆 外2名

ることを特徴とする特許請求の範囲第1項から無 4項までの何れか1項に記載の方法。

6. 精製すべきケイ業材料に付加的に方位性で 化を行うことを特徴とする特許請求の範囲第1項 から第5項までの何れか1項に記載の方法。

7. 客融るつぼを加熱領域から20~40 m/時の速度で下降させることによつて方位性値化を行うことを特徴とする特許請求の範囲第6項配成の方法。

8. ホウ素含量の高いケイ素材料を厳初に密慰し、次に抽出用容融物と接触させることを特徴とする特許請求の範囲第1項から第7項の何れか1項に配収の方法。

9. 抽出用容融物として、フッ化カルシウムと ケイ酸カルシウムとの混合格融物を用いることを 特徴とする特許請求の範囲第8項配載の方法。 3.[発明の辞細な説明]

本発明の対象は太陽電池製造用のケイ素材料を 酸密液による侵出によつて精製する方法である。

本発明は先ず第一に太陽電池によるエネルギー

(2)

(1)

持開昭56- 32319(2)

発生と関連して考慮されるべきものであるo この ような太陽電池化よつて電気エネルギーと経済的 に競台し得るエネルギーを供給し得るためには、 十分に安伽なペース材料のケイ素を使用に供する ことが必好であるが、地球上にSiO2として実際 に無尽波な量で存在するケイ素は先ず増元してか ら、精製しなければならない。 病度な電子工学用 デバイスの製造に頭宮用いるようなケイ素材料の ガス相を終る情襲は、あまりにも費用がかかりす ぎろために、問題外とされるが、太陽電池用ケイ 孝の顔度にはこのような私い要求はなされていな いので、これより費用のかからない方法を適用す ることができる。例えば、ケイ案材料の精製方法 として、酸または酸准合物による処理から成る方 法が公知である(例えばスイス特許第567435 号明州書、米国特許第2972521号明細書およ び L. P. Hunt 等による " 冶金品質 ケイ素から太陽 電池品質ケイ芸への精製"太陽エネルギーの国際 シンポジウム会報 1976年参照 )。 しかしなが ら、これらの方法では、太陽電池の製造に十分と

(3)

~10<sup>-4</sup> パールの圧力下で1500~1700 C の温度における真空基発と組合わせることによつ て解決することができる。

精製のためにケイ本に真空処理を行うことは、すでにL. P. Hunt等によつて研究されているが(Dow Lorning 社、Quart、Report № 2 ERDA /JPL/954559 - 76/1977年1月2日時)、これらの研究者による方法では精製効果を始んと挙げることができないので、原則としてこのような方法は設ましくないと彼らも勧告している。

は云えない純度のものが担られるばかりでなく、 非常に長い処理時間が必ずであつた。

ヨーロッパ特許出照無2135 身には、ケイ衆を金属密胞物中に加え入れ、この密融物中から時結晶し、抽出用解酸物によつて処理し、次に解酸物から偏析を利用して特要することから成る、ケイ素材料の相製方法が述べられている。この特許出類には費用のかからないケイ素の特要方法を砂つている他の文献も多く紹介されている。

また、個ドイツ公開馬2729464号公城にもケイ素の精製方法が述べられているが、この方法では本米公知の化学的精製設備を行う前に、ケイ素を解拠し、次に様々に脅却して再び応化させており、この方法ではケイ素の容繁物を抽出用解験物と接触させることもできる。

それ故、本希明は先行技術に比べてかなり低い 費用でかつ終容できる処理時間において、高い純 度に導びくような。ケイ素材料の精製方法を提供 することである。

この課題は、本来公知の化学的精製唆階を10<sup>-6</sup>

(4)

またフッ化水業修は2.5~10谷間のの即水等等として用いるのが合目的であるが、両者の酸水等額の混合物の場合は、混合物の水分含質に関しては当然また別の割合が生ずる。

約1kgのケイ素材料に約1~10 Lの療混合液 を加えることが、有利であると判明している。処 理時間は脳皮に依存しており、例えば20℃にお いて約4~48時間であるが、80℃においては 約1~24時間に短縮することができる。処理過 程間に使用された線の全体まだは1部を併出して 期脚な確または混合物成分と入れ歩えることがで きるoこの処理時間後に脚を除去し、得られた粉 米が脚を含まないように疣伸するo この方在の箟 ましい態様としては、この酸処理を原則的では真 空過程の次に行うことができるとしても、このよ うに予め精製した粉末を容融してから、真空疾発 を受けさせるものであるが、この方生の方が真空 処理の後に疵動状に発生するケイ紫を直接に ― 場合によつては付加的なドーピングを行つた後に 一 太陽電池用小ブレートに納造できるので大抵

(6)

の場合望ましい。

歴処理後に得られたケイ素別末を次に、例えば アルゴン、選業またはこれらの混合物のような保 護ガス下で、常圧または常圧よりやや一約0.3パ ールまで一被圧した圧力において容融する。次に、 圧力を徐々に成ずるが、もし徐々に行わない場合 にはケイ素容融物に含まれる不純物のために、し ばしば負

適当なるつぼ材料としては例えば、高い密度を有するかまたは孔質でない物質を塗布できる無鉛、炭化ケイ素または窒化ケイ素が挙げられる。また、るつぼ中の溶験物の深さは約30㎝までが有利である。例えばケイ酸カルシウム/フッ化カルシウムの保護溶験物を任意に塗布した無鉛スターラーによつて。または中位の財波数範囲における誘導技术によって容融物を撹拌する場合には、勿論さらに深い溶験物深さで行うことができる。

約1 $0^{-6}\sim10^{-4}$  パールの低圧に達した後に、 ケイ紮容融物の蒸発を約 $0.5\sim2$  時間にわたつて 有利に行うことができる。

" (7)



また、真空蒸発後に加勢領域から徐々にあつば 全体を下げることが特に望ましく、この場合にも 制御された条件下で固化した粗粒な精製ケイにの場合に、 接入物の大きされるのはたに、 在 初のれる。この場合に、 接入物の大きされるのが有 利である。この実施態様で操作するのが有 利である。この実施態様でも、 よの が固分に不純物が智様するので、 この はならない。 加熱るつばを下降させる ればならない。 加熱るつばをではることに不 のですでに折出しており、 この場で酸が はなってではなく、 固化のいで粉砕を かてまたは粉砕中に行うことが有利である。

精製すべき治金品質ケイ素が、太陽電池ベース 材料の場合に絶対的なより集合量と理解される。 約10ppm以上の高いより集合量を有している場合には、唇融ケイ素を抽出用路融物にも接触させ ることが有利である。抽出用路融物による処理は 必要に応じて行われるものであるが、最初の段階 特開昭56~ 32319(3)

このように精製したケイ紫は次に一例えば西ドイツ公告第2508.803号公報に従がつてー 小ディスクまたはインゴットとしての太陽電池ペース材料に直接網査することができる。

他の精製法としては例えば、쯈融物からケイ案 棒を引上げることから成る、公知の \* Czochralski 法 \* (W. R. Runyan による \* ケイ製半導体テクノ ロジー " 34~39頁。McGraw Hill 出版。1965 年)に従つて密啟ケイ素に方位性ある歯化を生じ させることによつて精製を行うことができる。こ の方法で単結晶成長が望ましい場合には、単結晶 を密触物の表面下に沈め、回転させながら、この 単結晶上に折出するケイ製を舞の形状に折出させ るのであるが、太陽電池材料としては単結晶成長 が必らずしも必要ではないので、最大約100 mm /時まで、望ましくは約50~75 ㎜/時の速い 引上げ速度を通用して、純度が高く、粗粒な結晶 性材料を得ることが可能である。溶触物の最後の 約10容量多は不細物がこの部分に審積している ので、冶金品質ケイ素に戻し入れるのが望ましい。

(8)



として行うのが合目的である。再び危化したケイ 異を次に細かくすり砕き、鬱で処理し、再び容融 してから、真空疾発によつて再精製する。抽出用 母触物としては、例えばケイ酸カルシウムおよび ケイ酸マグネシウムのようなケイ酸アルカリ土。 好に例えばフッ化カルシウムおよびフッ化マグネ シウムのようなフッ化アルカリ土、ならびに例え ばフッ化カルシウムとケイ酸カルシウム、フツ化 マグネシウムとケイ酸マグネシウムならび化ケイ 酸カルシウムとケイ酸マグネシウムとから成るよ うな混合俗触物が適している(例えば西ドイツ将 計第1022806号明細書ならびに米国特許第 3871872号明細書参照)。 ケイ酸カルシウ ムを30~10重量男(混合溶融物に関して)含 有するフッ化カルシウムから成る混合溶般物を酸 化性雰囲気下で用いた場合に、特に良好な結果が 得られる。

抽出時間は約0.5~1時間、温度は約1450 ~1600でであることが記ましい。 ケイ素に対 する抽出用症触物の鉱比は1:3~10:1の範

00



特開昭56- 32319(4)

掛で選択するごとが望ましい。

#### 吳ش例 1.

8 順覧 ppm のホウ 器含量を有するケイ素材料を 先ず最初にジョークラッシャーで粉砕し、振動撃 砂ミル中で20~60 umの範囲の平均构度を有 する粉末になるもですり砕くo このケイお材料粉 . 米を、20 電量場の塩糠5 4と10 電量場のフッ 「化水素螺50とから製造した酸混合物によつて、 80℃において10時間撹拌しながら浸出を行う。 次が、この粉末を遠心元争勝内で勝が無くなるま で优浄して、乾燥する。次に、この粉末を誘導加 熱真空祭殿裝備内で、 Q.65パールのアルゴン不 **治性ガス芽囲気下において客轍し、容融物を1600** でに維持した。この操作間に熔敏物は内径15 mm の黒鉛るつぼ内に12mの密報物保さで存在した。 30分間内に圧力を徐々に低下させることによつ  $\tau 5 \cdot 10^{-5}$  パールの真空に调節した。この場合、 約1時間かかる真空泰発は黒鉛機拌機を用いて密 脚物を撹拌することによつて促進することができ to

Q D

冱 1 表

### 純度表示(重數ppm)

兀 套	ケイが材料	其临州 1	美雕树 2
Fe	3500	1, 5	0,2
Aı	1200	<b>'</b> <1	< 0,2
Ca	1500	<1	< 0,5
Min	300	< 0,5	< 0,1
Тi	300	0,5	< 0,1
Úr.	4 0	< 1	< 0, 1
Üu .	40	< 0.5	< 0,1
В	8	8	7
P	3 0	<1	<1

## 実施例 3.

30萬電 ppmのホウ米含菓を有するケイ業材料 5 kpを誘導加熱風船るつば内において、CaF2 4 kp + 4a0 3 kp + SiO2 3 kp から成る、工業的純度の 抽出用が触物と共に容服し、1450~1500 で の範囲の傷場に約30分間、容認物を移触させて 次に、ケイ素格融物を腐敗勾配の作用下で鍋荷して、太陽増也用に乗した柱状構造を有するインゴットを作製した。このインゴットを切断して、小ディスクをホウ業ドーピングを有する太陽電池を形成するように加工した。 物処理に続けてロ学 法発を行うことによる本発明の特製方法の成果は第1級から明らかである。

#### 実施例 2.

8 乗舗 PPMのホウ美含量を有するケイ条材料を実施例1と同様に粉砕、零砕し、砂で度出を行つてから、真空処理した。次に無約るつぼを加外領 吸から2 5 mm/時の速度で下降させることによって、ケイ素容融物に方位性のある歯化を行つた。このようにして形成された結晶構造は、症状に配位した大きい粒度を示した。ケイ素の最初に歯化した半分の細蔵は第1表に記載した。このケイ素 から小ディスクを切断し、ホウ素ドーピングを有する太陽電池に加工した。

02

保持した。この容融物抽出は耐化性準単気(空気) 下で行つた;(この操作は燃焼によるるつぼ損傷 を滅ずるために、窒素原用気下で行うこともでき る)。

抽出期間後に、フッ化カルシウムーケイ増カルシウムー容融物からケイ素を鋳込みによつて分離し、 展鉛チル中で徐々に動電する。次に実施例1と同様に兼処理、真空処理を行つて、更に稍要する。 続いて、ケイ素容融物をインゴット状に両症し、 これを小ディスクに切断して、これから太陽電池 を作数する。 敵初に含まれていた不便物成分に満 して、得られた純度を退2表に配力する。

華 2 米

純度表示(電視 ppm)

兀声	<b>ケイ安材料</b>	寒病例 3
Fe	3000	1
Aı	1500	< 1
Ca	1500	< 1
Mn	300	< 0,5
Ti	3 D u	0,5
٥r	4 0	< 1
Cu	4 0	< 0,5
В	<b>5</b> 0	8
P	3 0	<1

代 埋 人 弁理士(8107) 佐 々 木 府 優 (はか2名) (はか2名) 経済で

**a** 5)

Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 56-32319

Publication Date: April 1, 1981

Title of the Invention:

PURIFICATION METHOD OF SLICON MATERIAL Claims:

- 1. A method for purifying a silicon material for producing a solar cell by leaching with an acid solution, characterized in that a chemical purification stage known in the art and vacuum evaporation at a pressure of  $10^{-6}$  to  $10^{-4}$  bars and a temperature of 1,500 to 1,700°C are carried out in combination with each other.
- 2. A method according to claim 1, wherein said vacuum evaporation is carried out after and in succession to said leaching by the acid.
- 3. A method according to claim 1 or 2, wherein said silicon material to be purified is pulverized to a grain size of 20 to 60  $\mu m\,.$
- 4. A method according to any of claims 1 through 3, wherein a mixture of aqueous hydrochloric acid and hydrofluoric acid is used as said acid solution.
- 5. A method according to any of claims 1 through 4, wherein 1 to 10 liters of water is added to 1 kg of silicon.
- 6. A method according to any of claims 1 through 5, wherein azimuthal solidification is additionally carried out for said silicon material to be purified.
- 7. A method according to claim 6, wherein said azimuthal solidification is carried out by lowering a

melting crucible from a heating area at a rate of 20 to 40 mm/hour.

- 8. A method according to any of claims 1 through 7, wherein a silicon material having large silicon content is first molten and is then brought into contact with a molten matter for extraction.
- 9. A method according to claim 8, wherein a molten mixture of calcium fluoride and calcium silicate is used as said molten matter for extraction.